

第23回電解プロセス研究会および第88回電解科学技術委員会

日時：2012年9月18日（火） 13:30～17:00

場所：京都大学本部キャンパス 工学部6号館363室

会場案内：<http://denkai.electrochem.jp/kyodai.pdf>

プログラム：

(1) 13:30～14:20

「溶融塩電解による高純度シリコン製造プロセスの開発」

産業技術総合研究所 大石哲雄 先生

(2) 14:20～15:10

「溶融塩からのタングステン電析技術の開発と応用」

住友電気工業 新田耕司 博士

(3) 15:20～16:10

「水素／空気二次電池の開発と今後の展開」

同志社大学 盛満正嗣 先生

(4) 16:10～17:00

「イオン液体を用いた次世代電気めっき」

大阪大学 津田哲哉 先生